

# 二氧化钒靶材VO2磁控溅射靶材

产品名称	二氧化钒靶材VO2磁控溅射靶材
公司名称	北京晶迈中科材料技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晶迈中科 型号:根据客户要求定制 产地:北京
公司地址	北京市通州区张家湾镇北大化村东(北京五木服装有限责任公司)2幢二层B2256 (注册地址)
联系电话	010-86208200 13301329625

## 产品详情

科研实验专用 二氧化钒靶材VO2磁控溅射靶材电子束镀膜蒸发料

### 产品介绍

二氧化钒 (VO<sub>2</sub>) 为深蓝色晶体粉末，单斜晶系结构，不溶于水，易溶于酸和碱中，溶于酸时生成正二价的钒氧离子，密度为4.260g/cm<sup>3</sup>，熔点为1545℃，在干的氢气流中加热至赤热时被还原成三氧化二钒。用作玻璃、陶瓷着色剂；二氧化钒在材料世界以其迅速和突然的相变而显得与众不同，其相变温度为68℃，相变前后结构的变化导致对红外光由透射向反射的可逆转变，人们根据这一特性将其应用于制备智能控温薄膜；二氧化钒所具有的导电特性让其在光器件、电子装置和光电设备中具有广泛的应用潜力；由于其优异的导电特性，也同时应用于电子器件。

### 产品参数

中文名二氧化钒 化学式VO<sub>2</sub>

分子量82.94 熔点 1545

密度 4.260g/cm<sup>3</sup>

支持靶材定制，请提供靶材产品的元素、比例（重量比或原子比）、规格，我们会尽快为您报价！！

服务项目：靶材成份比例、规格、纯度均可按需定制。科研单位货到付款，质量保证，售后无忧！

产品附件：发货时产品附带装箱单/质检单/产品为真空包装

适用仪器：多种型号磁控溅射、热蒸发、电子束蒸发设备

质量控制：严格控制生产工艺，采用辉光放电质谱法GDMS或ICP光谱法等多种检测手段，分析杂质元素含量保证材料的高纯度与细小晶粒度；可提供质检报告。

加工流程：熔炼 提纯 锻造 机加工 检测 包装出库

陶瓷化合物靶材本身质脆且导热性差，连续长时间溅射易发生靶裂情况，绑定背靶后，可提高化合物靶材的导热性能，提高靶材的使用寿命。我们强烈建议您，选购陶瓷化合物靶材一定要绑定铜背靶！

我公司采用高纯铜作为焊料，铜焊厚度约为0.2mm，高纯无氧铜作为背靶。

注意：高纯铜的熔点约为1083℃，靶材工作温度超过熔点会导致铜熔化！绑定背靶不影响靶材的正常使用！

建议：陶瓷脆性靶材、烧结靶材，高功率下溅射易碎，建议溅射功率不超过3W/cm<sup>2</sup>。